

고순도 Ptfе 오버플로우 피클링 탱크 일체형 무이음 폴리테트라플루오로에틸렌 실험실 세척 싱크대

품목 번호: PL-CP32



소개

공격적인 화학적 피클링을 위해 일체형 무이음 구조로 설계된 고순도 PTFE 오버플로우 탱크를 엔지니어링했습니다. 이 내구성이 뛰어난 용접 없는 싱크대는 제로 누설을 보장하고 까다로운 반도체 및 산업용 실험실 응용 분야에 탁월한 화학적 내성을 제공합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 웨이퍼 에칭	실리콘 웨이퍼에서 박막 및 산화물 층을 제거하기 위한 고순도 산 배스.	제로 미량 금속 오염 및 정밀한 배스 농도 제어.
태양전지 텍스처링(Texturing)	광 흡수 특성을 향상시키기 위한 태양등급 실리콘의 대규모 화학 처리.	공격적인 텍스처링 제제에 대한 화학적 저항성 및 장기 내구성.
정밀 금속 피클링	항공우주 및 의료용 등급 특수 합금에서 표면 불순물 및 스케일 제거.	구조적 열화 없이 진한 산 혼합물 견딤.
미량 분석 준비	일정 흐름 고순도 산 환경에서 실험실 유리 기구 및 센서 세척.	초저 배경 노이즈 및 분석 물질 흡착 방지.
제약 세척	공격적인 살균제를 사용하여 고순도 구성 요소의 멸균 및 세척.	매끄러운 다공성이 없는 표면은 박테리아 성장 및 화학적 잔류를 방지.
배터리 연구	리튬 이온 및 플로우 배터리 개발을 위한 부식성 전해질에서 전극 재료 테스트.	완전한 화학적 격리 및 전해질 유발 누설 방지.
전기 도금 배스	특수 금 또는 백금 도금 공정을 위한 안정적이고 비반응성인 용기 제공.	탱크 재료로 인한 전기화학적 간섭 제거.
화학 저장	금속 또는 유리 표면과의 접촉이 제로여야 하는 초순수 시약의 장기 보관.	장기 저장 기간 동안 시약 등급 유지.

특징	사양 세부 정보 (모델: PL-CP32)
기본 재료	100% 순수 고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
제조 방식	일체형 원피스 CNC 가공 (무이음/용접 없음)
작동 온도 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
화학적 저항성	보편적 저항성 (용융 알칼리 금속 및 불소 원소 제외)
설계 유형	내부/외부 일체형 오버플로우 시스템
벽 두께	표준 10mm ~ 30mm (완전 사용자 정의 가능)
표면 마감	고정도 매끄러운 마감 (Ra < 0.8 µm 가능)
치수 용량	소형 실험실 규모부터 대형 산업용 부피까지 주문 제작
포트 구성	선택적 PFA/PTFE 나사산 포트, 플랜지 연결 또는 오버플로우 위어

특징	사양 세부 정보 (모델: PL-CP32)
인증	클린룸 사용을 위한 재료 안전성 및 순도 규정 준수
사용자 정의 옵션	치수, 벽 두께, 뚜껑 설계, 내부 배플 및 센서 마운트